

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】令和 2 年 7 月 30 日 (2020.7.30)

【公表番号】特表 2019-527253 (P2019-527253A)
 【公表日】令和 1 年 9 月 26 日 (2019.9.26)
 【年通号数】公開・登録公報 2019-039
 【出願番号】特願 2018-567681 (P2018-567681)
 【国際特許分類】

C 0 9 J 7/40 (2018.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

C 0 9 J 201/00 (2006.01)

【F I】

C 0 9 J 7/40

B 3 2 B 27/00 M

C 0 9 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 6 月 18 日 (2020.6.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

接着剤物品の製造方法であって、

第 1 及び第 2 の両主面を有するライナーであって、第 1 のシリコン剥離層が前記第 1 主面上に配置されており、第 2 のシリコン剥離層が前記第 2 主面上に配置されており、前記第 2 のシリコン剥離層がオニウム塩光酸発生剤を含まないライナーを提供することと、

前記オニウム塩光酸発生剤を前記第 2 のシリコン剥離層の少なくとも一部分に適用して、変性シリコン剥離層を提供することと、

前記第 1 のシリコン剥離層の上に接着剤層を配置することと、

少なくとも前記接着剤層をプロセスチャンバ内の電子ビーム照射に曝露し、それによって架橋接着剤層を提供することと、

を含み、前記プロセスチャンバは酸素を含み、前記変性シリコン剥離層が前記接着剤層の架橋中に前記酸素にさらされる、製造方法。

【請求項 2】

前記オニウム塩光酸発生剤が、ジアリアルヨードニウム塩又はトリアリアルスルホニウム塩を含む、請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 3】

前記オニウム塩光酸発生剤が、ジアリアルヨードニウム塩を含む、請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 4】

前記電子ビーム照射が、前記接着剤層及び前記変性シリコン剥離層の両方に、それぞれ向き合った方向から向けられる、請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 5】

前記第 1 のシリコン剥離層が、オニウム塩光酸発生剤で硬化したシリコンを含まない、請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 6】

前記架橋接着剤層を前記変性シリコーン剥離層の上に巻き取ること、を更に含む、請求項 1 に記載の製造方法。